

Wyniki XXXII Konkursu PKO_{pto} 2023 im. Profesora Adama Smolińskiego na najlepsze prace dyplomowe z zakresu optoelektroniki

Tytuł pracy	Autor	Uczelnia	Prowadzący pracę
Nagroda I stopnia – 5 000 zł			
Laser światłowodowy pracy ciągłej z szerokim zakresem strojenia	inż. Przemysław Chmielowski	Politechnika Wrocławska	dr hab. inż. Michał Nikodem
Poszukiwania ultralekkiej ciemnej materii przy pomocy sieci czujników kwantowych nowej generacji	mgr Grzegorz Łukasiewicz	Uniwersytet Jagielloński	prof. dr hab. Szymon Pustelny
Nagrody II stopnia – 3 500 zł			
Multipleksacja czujników światłowodowych z wykorzystaniem kodów o dobrych własnościach korelacyjnych	mgr inż. Juliusz Bojarczuk	Politechnika Warszawska	dr inż. Konrad Markowski
Optymalizacja oświetlenia w wielowiązkowej profilometrii holograficznej ze względu na topografię badanego obiektu	mgr inż. Patryk Mitura	Politechnika Warszawska	prof. dr hab. inż. Tomasz Kozacki
Nagrody III stopnia – 2 000 zł			
Pasywne struktury rezonansowe fotoniki scalonej na platformie azotku krzemu	mgr inż. Michał Golas	Politechnika Warszawska	dr inż. Konrad Markowski
Charakteryzacja fotodiod extended InGaAs osadzanych na podłożu InP metodą MOCVD	mgr inż. Kacper Matuszelański	Wojskowa Akademia Techniczna	płk. prof. dr hab. inż. Piotr Martyniuk
Opracowanie i kalibracja stanowiska do pomiaru promieniowania tła z zakresu UV-C. Analiza budżetu niepewności pomiarów	mgr inż. Dawid Wróblewski	Wojskowa Akademia Techniczna	dr inż. Marek Zygmunt
Wyróżnienia			
Analiza wpływu wygrzewania na właściwości powierzchni i gazochromowe cienkich warstw tlenku wolframu	mgr inż. Wiktoria Weichbrodt	Politechnika Wrocławska	dr hab. inż. Michał Mazur, prof. uczelni
Photonic structures created by photopolymerization of liquid crystal mixtures	mgr inż. Marta Kajkowska	Politechnika Warszawska	dr inż. Miłosz Chychłowski
Analiza trwałości czujników światłowodowych pokrytych cienkimi warstwami tlenku indu cyny	inż. Hubert Rutkowski	Politechnika Warszawska	dr inż. Monika Janik
Exfoliation of layered materials: setup of microscope for mechanical exfoliation and basic investigation of fabricated samples	inż. Maciej Śmiałka	Politechnika Wrocławska	dr Alessandro Surrente